(54) OPTICAL DISK

(11) 5-89523 (A)

(43) 9.4.1993 (19) JP

(21) Appl. No. 4-16757 (22) 31.1.1992 (33) JP (31) 91p.216144 (32) 31.7.1991

(71) KYOCERA CORP (72) TAKESHI KYODA(2)

(51) Int. Cls. G11B7/24.G11B11/10

PURPOSE: To prevent the generation of the warpage of an optical disk by substantially equaling the products of the internal stresses of 1st and 2nd resin protective layers respectively formed on both surfaces of a plastic substrate and the thickness of the layer.

CONSTITUTION: At least an optical recording layer is formed on one surface of the plastic substrate and the resin protective layer is formed thereon. The 2nd resin protective layer is formed on the other surface. The internal stresses (force per unit sectional area) generated in the 1st and 2nd resin protective layers are respectively designated as σ_n and σ_s and are so set that the conditions of σ_n×σ_n =σ_n×σ_n substantially hold. The internal stresses generated in the respective resin protective layers on both surfaces of the plastic substrate are substantially equaled in this way and, therefore, the generation of the warpage of the optical disk is prevented.



(54) AIR SANDWICH TYPE OPTICAL DISK

(11) 5-89524 (A) (43) 9.4.1993 (19) JP

(21) Appl. No. 3-251445 (22) 30.9.1991

(71) RICOH CO LTD (72) EIJI NODA

(51) Int. Cl3. G11B7/24

PURPOSE: To prevent the writing error generating when microparticles stick to a recording layer by interposing a dust absorbing member consisting of electret fibers into a hollow part generated by sticking substrates to each other via a snaer.

CONSTITUTION: The substrates I are stuck by a UV curing adhesive 4 of an acrylic system to form the hollow part. The substrates are so adhered that the adhesive 4 in the spacer 3 of the hollow part is made into a C shape. The break thereof is an air hole 6 to the hollow part 5. The dust absorbing member 7 is interposed into such a position where this vent hole 6 is closed. The dust absorbing member 7 consists of the electref fibers. The dust absorbing member 7 is formed thicker than the thickness of the spacer prior to scaling. The member is then compressed to the extent of not impairing the air permeability and is interposed into the hollow part. The dust absorbing member 7 functions effectively if the disk is formed in such a manner.



(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(11) 5-89525 (A) (43) 9.4.1993 (19) JP

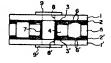
(21) Appl. No. 3-276939 (22) 27.9.1991

(71) RICOH CO LTD (72) FUMIYA OMI

(51) Int. CP. G11B7/24

PURPOSE: To prevent the adhesion of dust by electrification of the recording layers of an air sandwich structure (hollow structure) type optical recording medium and to obviate an increase in errors.

CONSTITUTION: The recording layers 2, 2' consisting of org, dye films are formed on resin substrates 1, 1' and further, vapor deposited Au films 3, 3' are formed on the inner peripheral parts (the side inner than recording areas). A pair of the substrates 1, 1' with the recording layers are so spaced and disposed to face each other that the recording layer 2, side exists on the inner side. These substrates are joined by the adhesive layers 6, 6' via the inner peripheral spacer 5 disposed concentrically therebetween. The inner ends of the vapor deposited Au films 3, 3' are brought into electrical contact with each other by applying silver paser? thereon. The two recording layers 2, 2' are brought into electrical contact with each other in this way and the sticking of the dust by the electrification is prevented.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-89523

(43)公開日 平成5年(1993)4月9日

(51)Int.Cl.⁶
G 1 1 B 7/24
11/10

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2(全 5 頁)

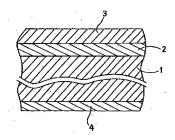
(21)出願番号	特顯平4-16757	(71)出類人	000006633 京セラ株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)1月31日		京都府京都市山科区東野北井ノ上町 5番地の22
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	特顯平3-216144 平 3 (1991) 7 月31日 日本 (JP)	(72)発明者	京田 豪 滋賀県八日市市蛇牌町長谷野1166番地の 6 京セラ株式会社滋賀八日市工場内
		(72)発明者	
		(72)発明者	有宗 久雄 滋賀県八日市市蛇藤町長谷野1166番地の 6 京セラ株式会社滋賀八日市工場内
		1	

(54) 【発明の名称】 光デイスク

(57)【要約】

【目的】 ブラスチック基板の両面に樹脂保護層を設けた光ディスクの反りを低減すること。

【構成】 プラスチック基板の一方の面に少なくとも光 記殿間が形成され、その上に樹脂保護層が形成されると ともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される光 イスクにおいて、この第1及び第2の樹脂保護層の厚さ をそれぞれも1及び4,とし、第1及び第2の樹脂保護層の厚さ 値に生する内部広力(単位断面指きりの力)をそれぞ れゅ1及び4,として、実質的につ,×d,=の,×d 1の条件が成立するようにしている。これにより、プラ スチック基板の両面の名樹脂保護層に生ずる内部広力が 実質的に等しくなってパランスするので、光ディスクの 反りの発生が極力防止される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラステック基板の一方の面に少なくと も光密機層が形成され、その上に樹脂保護層が形成される とともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される 光ディスクにおいて、前記第1及び第2の樹脂保護層の 厚さをそれぞれd,及びd。とし、第1及び第2の樹脂 保護層に生ずる内部な力をそれぞれ。及び。とした 場合に、実質的に下配の(1) 太が成立するようにした ことを特徴とする光ディスタ。

 $\sigma_1 \times d_1 = \sigma_2 \times d_2$ (1)

【請求項2】 前記第1及び第2の樹脂保護層に、水との接触角が30°未満の無機質粒子を分散させたことを特徴とする請求項1に記載の光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プラスチック基板に光 記録層を形成した光ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】現在、CD-ROMのような記録情報の 読み取り専用(リード・オンリー)型、情報を一度だけ 20 書き込めるライト・フンス型、情報の再書き込みが可能 なリライタブル型等の光ディスクが開発され実用化され 始めている。

【0003】このような光ディスクの基板材料としてガ プラスキックは加工や複数が容易であり、材料コストの 面でも有利である等の理由でガラス基板よりも好適に使 用されている。このプラステック基板の一方の面には少 なくとも光距線層が形成され、この光距線層を外的な 傷、水分による腐食等から保護するために、光距線層の は、水分による腐食等から保護するために、光距線層の が男外線便化型樹脂や製造し下されている第1の樹脂保護層 が男外線便化型樹脂や製造し下されている第1の樹脂保護層 が形成される。また、他方の面には基板表面への外的な傷や静電 気による塵埃の付着等を防ぐために、一般にハードコー ト層と称されている導电性を付与した第2の樹脂保護層 が形成される。この第2の樹脂保護層の材料としては第 1の樹脂保護層と同様に繋が極寒便化型樹脂 は、はいいのは、といいのは、はいいのは、 1の樹脂保護層と同様に繋が極寒便と樹脂や熱寒便と樹脂 相などが用いられる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のような硬化型樹脂は塗布後の硬化収縮によって内部応力が生じ、更に高温高温の環境下に長時間さらされた場合などの経時変化に伴う体視収縮によっても内部応力が生ずる。特に、後者の経時変化に伴う応力発生は影響が大きく、ガラス基板によて剛性が小さいブラステック基板の場合には、両面の樹脂保護層の内部応力の差による反りが顕著に発生しやすいという問題があった。

層の内部応力とをパランスさせることにより、製造時に おける光ディスクの反りを小さくすることが提案されて いるが、このような提案では基板の両面に形成された樹 開保護層の経時変化によって生ずる反りを低減させるこ とはできない。

【0006】そこで、本発明は上述の問題点に着目し、 プラスチック基板の両面に制指保護層を設けた光ディス クの反りを低減することを課題としてなされたものであ る。

10 [0007]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するために、本発明では、プラステック基板の一方の面に少なくとも光記録層が形成され、その上に樹脂保護層が形成されるとともに、他方の面に第2の樹脂保護層が形成される光ディスクにおいて、この第1及び第2の樹脂保護層に生する内部応力(単位新面積当たりの力)をそれぞれも、及び6、として、実質的にσ,×d,の条件が成立するようにしている。これによ

20 り、プラスチック基板の両面の各樹脂保護層に生ずる内部応力が実質的に等しくなってバランスするので、光ディスクの反りの発生が極力防止される。

100081

【実施例】以下、本発明に係る実施例を詳細に説明する。図1において、1はポリカーボネート樹脂の基板 2は光記段階、3は第1の樹脂保護層である樹脂保護 層、4は第2の樹脂保護層であるハードコート層を示 す。

【0009】光距髪間 2は、マグネトロンスバッタリング装置を用いて非晶質イットリウムサイアロンの第1 骸 電休房 (100 nmg)、非晶質 G d 一 D y ー F e 系の光盤 気配録層 (20nm厚)、非晶質イットリウムサイアロンの 第2 勝電体層 (30nm厚)、及び金属ブルミニウム反射層 (100 nmg) を確放物園 たためのである。

【0010】また、樹脂保護層3とハードコート層4と は以下に示す各種樹脂試料、すなわち樹脂A、B、C、 D、E、Fについて後途する試験を行い、これら樹脂の うち最適なものを整布して形成した。

【0011】 ここで、樹脂Aとしてはアクリル酸エステル系の紫外線硬化型樹脂(大日本インキ(株)製 SD-17)を、また樹脂Bとしては、ウレタンアクリレート系の紫外線硬化型樹脂(大日本インキ(株)製 SD-301)をそれぞれ使用し、樹脂AにSb-Snの(粒径扱り、15μm, 木に対する接触角の = 約5°)のフィラーを混入させたものを樹脂Cとした。また、アクリル系の紫外線硬化型樹脂(三菱レイョン(株)製アクリル系樹脂)にSiの(放篭 ~ 8 μm, 6 = 0−10°)のフィラーを混入させたものを樹脂Dとし、樹脂AにA1,0、(板能・~8 μm, 6 = 20~30°)のフィラーを混入させたものを樹脂Dとし、樹脂AにA1,0、(板能・~8 μm, 6 = 20~30°)のフィラーを

【表2】

(3)

(粒径4 \sim 6 μ m, θ =約88°) のフィラーを分散させた ものを樹脂下とした。

【0012】上記各樹脂の経時変化後の内部応力を調べ るために、事前に次のような試験を行った。すなわち、 75μm の薄い板ガラス基板に各樹脂を塗布成膜した後、 80℃、90% R Hの高温高湿試験を1000時間実施し、その 前後における基板の反りを測定して内部応力を算出し、 また鉛筆硬度についても測定を行った。その結果は表1 に示すように、樹脂Aの場合は1 ×10-7dyn/cm2、樹脂 Bは3 ×10*dyn/cm2、樹脂Cは8 ×10*dyn/cm2、樹 脂Dは4 ×10*dyn/cm2、樹脂Eは5 ×10*dyn/cm2、 樹脂Fは6 ×10*dyn/cm*であった。また、表には示し ていないが、フィラーを樹脂に混入させた試料(樹脂 C, D, E, F) の場合、反り角を示すチルト角は試験 開始後約250 時間程度で飽和し、以後ほとんど変化しな いことが判明し、特に、水との接触角が30°未満の材質 のフィラーを樹脂に混入させた試料(樹脂C, D, E) は、鉛筆硬度がフィラーが無い試料と同様であって、硬 度の低下が全くみられなかった。一方、水との接触角が 30°より大の材質のフィラーを樹脂に混入させた試料の 20 場合は硬度が著しく低下し耐傷性が不十分であった。こ れは、主剤となる樹脂との密着性が弱いために硬度が低 下したものと考えられる。なお、各樹脂層に生ずる実際 の内部応力はこれらの数値と層の断面積とから算出され る。

[0013]

【表1】

樹脂	内部応力 (dyn /cm²)	鉛筆硬度
A	1 ×10-7	2 H
В	3 ×10-*	2 H
С	8 ×10 ⁻⁸	2 H
D	4 ×10 ⁻⁸	2 H
Е	5 ×10 ⁻⁸	2 H
F	6 ×10-*	нв

* 【0014】実施例1~5及び比較例は、それぞれ表2 に示すように、樹脂保護層3とハードコート層4の樹脂 の種類と塗布厚さを選定してある。ここで、実施例1は 同一樹脂を同一厚さで塗布しており、実施例2~5は樹 脂の硬化収縮と体積収縮の変化量を考慮して樹脂保護層 3とハードコート層4の内部応力と層の厚さとの積が実 質的に等しくなるようにしている。ここで、実質的に等 しいとは、樹脂保護層3及びハードコート層4の厚さ (μm) をそれぞれd,及びd,とし、それぞれの層に 10 生ずる内部応力 (単位面積当たりの力; dyn/cm²) をそ れぞれ σ_1 及び σ_2 とした場合に、 $\sigma_1 \times d_1 \geq \sigma_2 \times$ d,との差が±10~dyn/cm以内の程度のことをいう。ま た、比較例はこの条件が成立しないようにそれぞれの樹 脂の種類と塗布厚さを選定してある。なお、内部応力の 正の値は引張り応力を示し、負の値は圧縮応力を示す。 また、実施例5は樹脂Bを約5 μm とし、この上に樹脂 Dを約6 μm 塗布したものである。 [0015]

5

	樹脂	呆護層	ハードコート層		光ディスクの反り (mrad)		
	樹脂	厚さ (μm)	樹脂	厚さ (μm)	初期	1000時間後	
実施例 1	В	10	В	10	0.8	0.8	
実施例 2	В	12	С	4	1.1	1, 1	
実施例 3	D	7	С	4	1.4	1,7	
実施例 4	Е	7	С	4	1. 3	1.5	
実施例 5	B+D	11	С	4	1.0	1.2	
比較例	В	10	A	5	1.5	3, 8	

【0016】このようにして形成した実施例1~5及び 比較例に対して、上述した80°C,90%RHの条件下での 高温高湿環境試験を1000時間実施し、その前後での反り 30 の変化を機械特性装置によりチルト角を測定して調べ た。表2に示すように、実施例1~5では初期の反りが 小さく、しかも環境試験後の反りに変化が極めて小さい のに対して、比較例では初期の反りは小さいが、環境試 験後では実施例1の4倍以上も増大した反りとなったう え剥離も生じていた。すなわち、樹脂保護層の形成時の 硬化収縮だけでなく、経時変化による体積収縮の変化量 を実質的に等しくすることにより、製造初期と経時変化 後の反りを小さい値に保持することができるのである。 【0017】なお、光ディスクを構成する基板や各層に 40 は上記以外の種々の材料が使用可能である。すなわち、 基板としてはエポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリエステ ル樹脂、非晶質ポリオレフィン樹脂等の各種樹脂が使用 可能である。 【0018】また、樹脂保護層とハードコート層として

【0018】また、樹脂保護層とハードコート層としては、アクリル酸エステル系、ウレタンアクリレート系、エボキシ系、ポリエステル系、アクリル系などの各種素外級便化型樹脂が使用可能であり、これら樹脂に混入させるフィラーとしては水との接触が30°以下の材質であればよく、例えばITO、S 50 用可能である。

b - S n O₁ 、 P - S n O₁ 、 S b, O₁ 、 I r O₂ 、 M o O₂ 、 N b O₃ 、 P t O₃ 、 R u O₃ 、 W O₃ 、 M o O₄ 、 N b O₅ 、 P t O₇ 、 R u O₇ 、 N b N 、 T a 、 N 、 T i N 、 Z r N 、 V N などの導電性のセラミックや S i O₅ 、 A 1, O₁ 、 S i n N 、 S i C 、 C d S 、 Z n S 、 S i O などの総縁性セラミック 、 A g 、 N i 、 A u 、 T i などの金属・合金などが単一あるいは 2 種以上の混合物として使用可能である。

【0019】また、第1及び第2務電体圏には、他に蜜 化シリコン、蜜化アルミニウム、蜜化チタン、炭化シリ コン、硫化カドミウム、硫化亜酸、フッ化マグネシウ ム、酸化カドミウム、酸化ビスマス等が単独あるいはこ れらを組合せた材料が使用可能である。

【0020】さらに、光磁気配線形には他にGd 一 Tb ー Fe 、 Tb ー Fe − Co 、 Dy − Fe − Co 、 Gd ー Tb − Dy − Fe ← Co 、 Tb − Dy − Fe ← Co 、 Tb − Dy − Fe − Co 、 Gd − Dy − Fe − Co 、 Nd − Gd − Dy − Fe ← Nd − Gd − Dy − Fe ← Co 系号の思ります。 Nd − Gd − Dy − Fe ← Co 系号の影を強属・布土類金属系の各種・非品質磁性合金が使用可能である。

【0021】また、反射層には他にCr、Ti、Cu、 Ag、Au、SUS等が単独あるいは組合せた材料が使 田可能である [0022] なおまた、上途の実施例では光磁気配験層を有したいわゆる光磁気ディスクの勘合について示した が、本発明は、光磁気配験開が無く反射層などから成る 光配験層を有したいわゆるCD-ROMのような光ディ スクでも適用可能であることはもちろんである。 [0023]

【発明の効果】上述の実施例から明らかなように、本発 明は、プラスチック基板の両面にそれぞれ形成される第 1及び第2の樹脂保護層の内部応力と層の厚さの積が実 質的に等しくなるようにしたものである。

【0024】したがって、基板の両面に発生する内部応力をバランスさせて反りの発生を防止することができるので、反りが生じやすいというプラスチックの問題点を解決して、他の多くの利点をいかんなく発揮させることが突易となり、特に大阪の光ディスクにとっては極めてま

* 有利となる。また、貼り合わせの光ディスクでは貼り合 わせ部での剥離をなくすことも可能となる。

【0025】さらに、上配樹脂保護層に水との接触角が 30°未満の無機質粒子を分散させることによって、高温 高温の過酷な環境下においても硬度の低下を極力防止す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る一実施例の光ディスクの構造を示す断面図である。

【符号の説明】

2の樹脂保護層

1		٠	基板	2		光
記象	录層					
3			第1の樹脂保護層	5		チ

図1]

